

第 14 章 知的財産権

1. 知的財産権保護の状況

ラオスは 1995 年に「世界知的所有権機関 (WIPO : World Intellectual Property Organization)」設立条約、1998 年に工業所有権の保護に関するパリ条約、2006 年に「特許協力条約 (PCT : Patent Cooperation Treaty)」にそれぞれ加盟した。さらに、2013 年 2 月に WTO に加盟を果たしたことから、TRIPS (知的所有権の貿易関連の側面に関する協定) にも加入した。

国の法制としては、2011 年 12 月に改正知的財産法 (No.01/NA) を公布した (改正前の法律は 2008 年知的財産法)。同法は、特許・意匠、商標、著作権をはじめとする基本的な知財権制度を包括的に規定している。同法律の制定を受けて知的財産法に関する首相令 (No.054/PM) が 2012 年 1 月に公布された。

知的財産に関する主な官庁は、科学技術省知的財産局 (Department of Intellectual Property) であり、特許や商標から著作権まで幅広く、その登録と権利保護を行っている。

ラオスにおける特許出願件数は年間 30 ~ 40 件にとどまっており、従って、特許出願の実体審査は行われず、対応する外国出願の審査結果を参照し、必要に応じて WIPO による先行技術調査支援制度を利用している²。

他方、商標については年間 2,000 件以上の出願を受理し、実体審査も自ら行っている。現在の平均的な審査期間は半年程度である。

他の開発途上国と同じように、ラオスでも模倣品や海賊版が市場に出回っているが、市場規模が狭く、所得水準が低いことから、権利者がラオスにおいて知財権を問題にすることはないといいよい。しかし、ラオスは権利者が問題とする中国の不正商品の近隣諸国 (ベトナム、ミャンマー、タイ) への流通ルートになっている場合があり、ラオスにおいて貨物が差し押さえられるケースが見受けられる³。

² 大熊 康夫「ASEAN 諸国の知財情勢」、『特許研究』No. 54、2012/9、p.78

³ 同上資料、p.79

2. 知的財産権保護の概要と留意点

図表 14-1 は保護対象となっている知的財産権の概要を示している。

図表 14-1 知的財産権の保護の概要

	法律	登録要件	優先制度	保護期間
特許 小特許	2011 年改正知財法・2012 年首相令	新規性・進歩性・産業上利用性	先順主義	特許：20 年間 小特許：10 年間
意匠	同上	新規性・装飾的	同上	15 年間
商標	同上	識別性	同上	10 年間
地理的表示	同上	商品が特定の地理的原産地に由来すること	同上	無期限
著作権	同上	-	-	著作者の死後 50 年間
集積回路の回路配置	同上	独自性	同上	12 年間
植物品種	同上	新規性、識別性、均一性、安定性	同上	木と蔓：25 年間 その他：20 年間

(出所) JETRO、「ラオス知財レポート」、2013 年 3 月より作成

以上の他、各知財権には次のような留意点がある⁴。

商標

- ・ 公用語であるラオス語の他、いかなる言語による商標も登録を受けることができる。但し、英語以外の外国語による商標の登録出願を行う場合には、英語による翻訳及び音訳を提出しなければならない。
- ・ 日本語商標を登録する場合の留意点：ラオスにおいて日本語商標の登録出願を行う場合には、当該商標の英語による翻訳及び音訳を用意する必要がある。登録された日本語商標の意味内容は翻訳または音訳されたものによることになるが、日本語文字の文字商標として取り扱われる。

特許

- ・ 国外に居住する出願人は、ラオス国内に代理人を置かなければならない、とされている(知財権法第 27 条)のみで、具体的な資格の要否や資格取得の手続きについては規定されていない。実務上、弁護士を特許代理人として選任することが一般的となっている。

⁴ JETRO、「ASEAN 各国における商標の言語に関する調査」2013 年 4 月(特許庁受託事業)(http://www.jetro.go.jp/world/asia/asean/ip/pdf/report_trademark_language_rev.pdf)

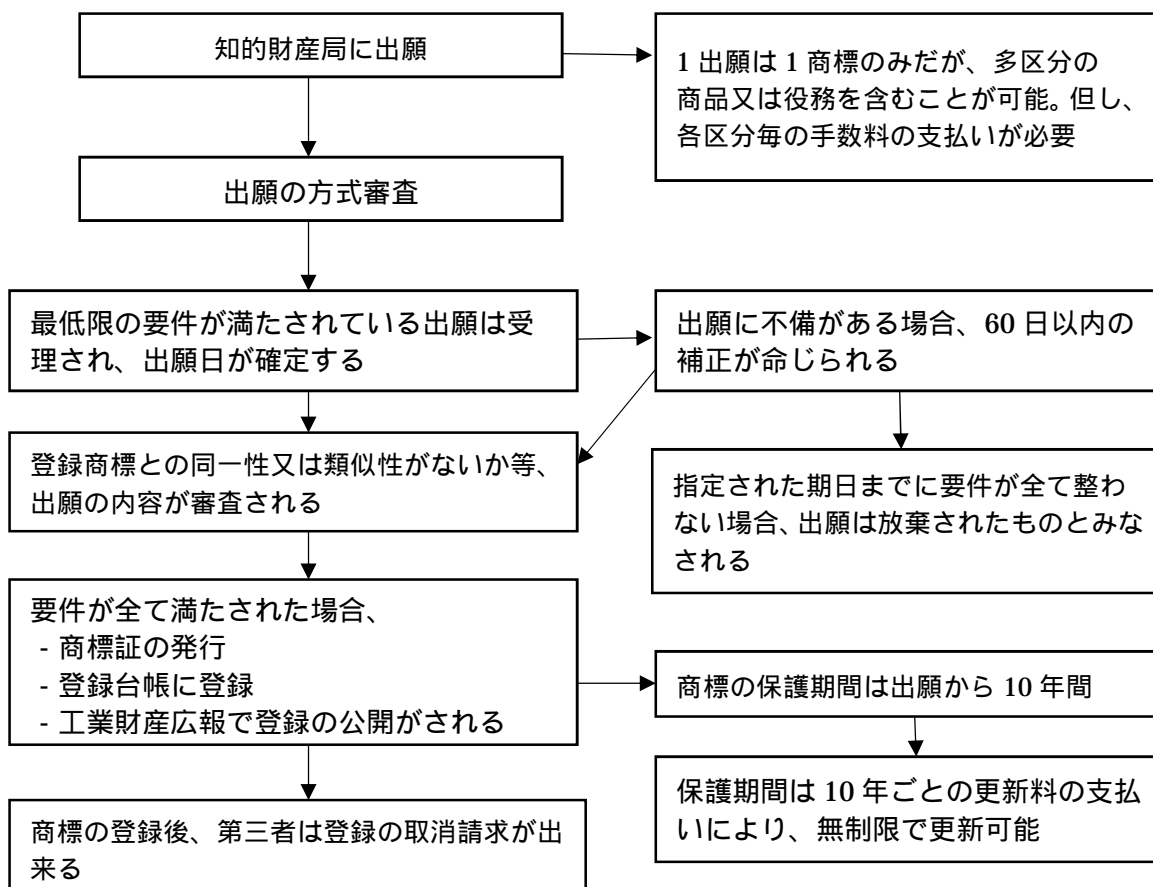
周知・著名意匠及び商標の保護

- ・ 周知商標（Well-known mark）は登録がなくても知的財産権法に基づき登録された商標と同様に保護されており、第三者に対して差止め請求及び損害賠償請求等の権利行使を行うことが出来る（2011年知財権法第16条第2項各号）。
- ・ 周知商標とは、ラオスの国内において一般的かつ広く認識されている商標であることを要する（同上法第3条第13号）。

3. 商標及び特許の出願手順

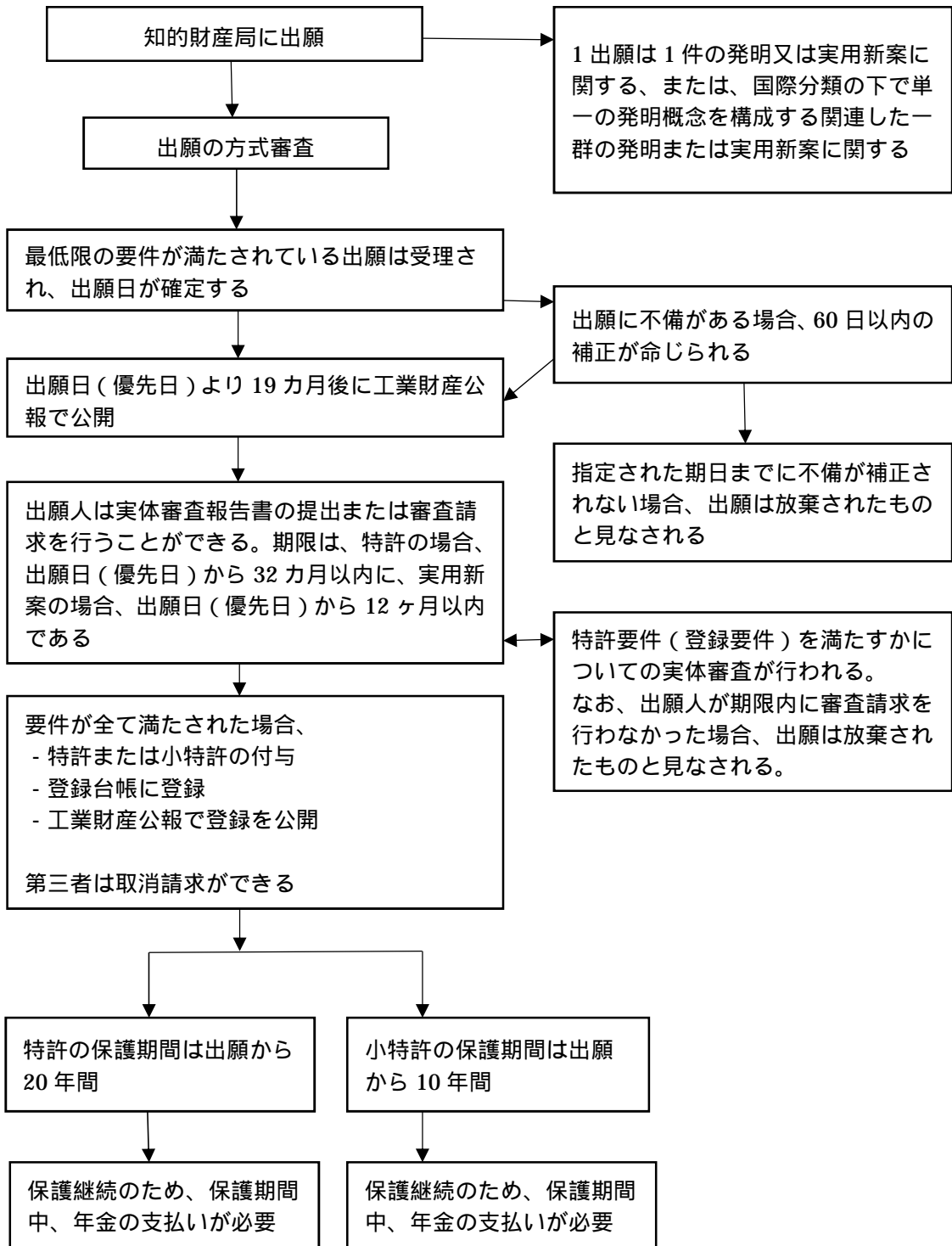
図表 14-2 は商標の出願手続きを、図表 14-3 は特許及び小特許の出願手続きを示している。

図表 14-2 商標の出願手続き



（出所）JETRO、「ラオス知財レポート」、2013年3月

図表 14-3 特許の出願手続きの流れ



(出所) 図表 14-2 に同じ。